【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和4年3月30日(2022.3.30)

【公開番号】特開2020-154235(P2020-154235A)
【公開日】令和2年9月24日(2020.9.24)
【年通号数】公開・登録公報2020-039
【出願番号】特願2019-54990(P2019-54990)
【国際特許分類】
Ｇ０９Ｆ　9/30(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 51/50(2006.01)
Ｈ０１Ｌ 27/32(2006.01)
Ｈ０５Ｂ 33/04(2006.01)
Ｈ０５Ｂ 33/22(2006.01)
Ｈ０５Ｂ 33/12(2006.01)
Ｈ０５Ｂ 33/10(2006.01)
Ｇ０９Ｆ　9/00(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０９Ｆ　9/30　３３８
Ｈ０５Ｂ 33/14　　Ａ
Ｈ０１Ｌ 27/32
Ｈ０５Ｂ 33/04
Ｈ０５Ｂ 33/22　　Ｚ
Ｈ０５Ｂ 33/12　　Ｂ
Ｈ０５Ｂ 33/10
Ｇ０９Ｆ　9/30　３６５
Ｇ０９Ｆ　9/30　３４８Ａ
Ｇ０９Ｆ　9/30　３４９Ｚ
Ｇ０９Ｆ　9/00　３３８

【手続補正書】
【提出日】令和4年3月22日(2022.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
表示領域、および前記表示領域を囲む周辺領域を有する基板、
前記表示領域上のトランジスタ、
前記トランジスタ上に位置し、前記トランジスタを覆う平坦化膜、
前記平坦化膜上に位置し、前記トランジスタと電気的に接続される表示素子、
前記周辺領域上に位置し、前記表示領域を囲むダム、ならびに
前記平坦化膜と前記ダムの間に位置し、前記表示領域を囲むガイドを備え、
前記ガイドは、前記平坦化膜に含まれる第１の有機化合物を含み、
前記ガイドは、複数のガイド絶縁膜を有し、
前記複数のガイド絶縁膜の高さは、前記ダムの高さよりも小さい、表示装置。
【請求項２】
前記複数のガイド絶縁膜は、前記ダムと前記平坦化膜の少なくとも一方から離隔する、請

求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
前記複数のガイド絶縁膜は、最長辺が前記表示領域へ向くように配置される、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
前記複数のガイド絶縁膜は、それぞれの最長辺が、前記最長辺から最も近い前記表示領域の辺に対して平行になるように配置される、請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
前記複数のガイド絶縁膜は、前記表示領域の前記辺に平行な方向において千鳥配置される、請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
前記表示領域上に隔壁をさらに有し、
前記表示素子は画素電極を有し、
前記隔壁は前記画素電極の端部を覆い、
前記ダムは、前記第１の有機化合物を含む第１の層、および前記第１の層上に位置し、前記隔壁に含まれる第２の有機化合物を含む第２の層を備える、請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
表示領域、および前記表示領域を囲む周辺領域を有する基板、
前記表示領域上のトランジスタ、
前記トランジスタ上に位置し、前記トランジスタを覆う平坦化膜、
前記平坦化膜上に位置し、前記トランジスタと電気的に接続される表示素子、
前記周辺領域上に位置し、前記表示領域を囲む第１のダム、
前記周辺領域上に位置し、前記第１のダムを囲む第２のダム、
前記平坦化膜と前記第１のダムとの間、および前記第１のダムと前記第２のダムの間の少なくともいずれかに位置するガイドを備え、
前記ガイドは、前記平坦化膜に含まれる第１の有機化合物を含み、
前記ガイドは、複数のガイド絶縁膜を有し、
前記複数のガイド絶縁膜の高さは、前記第１のダムの高さ、および前記第２のダムの高さよりも小さい、表示装置。
【請求項８】
前記平坦化膜と前記第１のダムとの間に位置する前記複数のガイド絶縁膜は、前記第１のダムと前記平坦化膜の少なくとも一方から離隔し、
前記第１のダムと前記第２のダムの間に位置する前記複数のガイド絶縁膜は、前記第１のダムと前記第２のダムの少なくとも一方から離間する、請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
前記複数のガイド絶縁膜は、最長辺が前記表示領域へ向くように配置される、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１０】
前記複数のガイド絶縁膜は、それぞれの最長辺が、前記最長辺から最も近い前記表示領域の辺に対して平行になるように配置される、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１１】
前記複数のガイド絶縁膜は、前記表示領域の前記辺に平行な方向において千鳥配置される、請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
前記ガイドは、前記平坦化膜と前記第１のダムとの間、および前記第１のダムと前記第２のダムの間に位置し、
前記平坦化膜と前記第１のダムとの間の前記複数のガイド絶縁膜の最長辺が延伸する第１の方向は、前記第１のダムと前記第２のダムの間の前記複数のガイド絶縁膜の最長辺が延伸する第２の方向と異なる、請求項７に記載の表示装置。

【請求項１３】
前記第１の方向は前記表示装置に向き、
前記第２の方向は、前記最長辺から最も近い前記表示領域の辺に対して平行である、請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
前記表示領域上に隔壁をさらに有し、
前記表示素子は画素電極を有し、
前記隔壁は前記画素電極の端部を覆い、
前記第１のダムと前記第２のダムのそれぞれは、前記第１の有機化合物を含む第１の層、および前記第１の層上に位置し、前記隔壁に含まれる第２の有機化合物を含む第２の層を備える、請求項７に記載の表示装置。
【請求項１５】
基板上にトランジスタを形成すること、
第１の樹脂を前記トランジスタを覆うように形成すること、
前記第１の樹脂を加工することにより、前記トランジスタ上の平坦化膜、前記平坦化膜を囲むガイド、および前記ガイドを囲むダムを形成すること、ならびに
前記トランジスタと電気的に接続される表示素子を形成することを含み、
前記ガイドは、前記第１の樹脂から形成される複数の絶縁膜を含み、
前記複数のガイド絶縁膜の高さを、前記ダムの高さよりも小さく形成する、表示装置の製造方法。
【請求項１６】
前記第１の樹脂の前記加工は、
透光部、遮光部、および半透光部を有するフォトマスクを、前記半透光部によって覆われる第１の領域が前記トランジスタから離隔しつつ前記トランジスタを囲むように、かつ、前記遮光部によって覆われる領域が前記第１の領域を囲むように第１の樹脂上に配置すること、
前記フォトマスクを介して前記第１の樹脂に光照射を行うこと、
前記第１の樹脂を現像することを含む、請求項１５に記載の表示装置の製造方法。